



KINTEK FURNACE

Cvd & Pecvd Furnace Catalogo

Contact us for more catalogs of [High Temperature Furnaces](#), ecc.

KINTEK FURNACE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Kintek Furnace è un innovatore guidato dalla tecnologia e specializzato in apparecchiature di precisione per laboratorio ad alta temperatura, tra cui forni a muffola, forni tubolari, forni a vuoto, sistemi ad atmosfera controllata e soluzioni avanzate CVD/PECVD. Progettati per la scienza dei materiali, la ricerca chimica e le applicazioni di trattamento termico, i nostri sistemi robusti ed efficienti dal punto di vista energetico danno priorità alla precisione, alla sicurezza e alla ripetibilità in ambienti a calore estremo, consentendo ai ricercatori e ai laboratori industriali di ottenere risultati rivoluzionari.



Sistema Rf Pecvd Deposizione Di Vapore Chimico Potenziata Al Plasma A Radiofrequenza

Numero articolo: KT-RFPE



introduzione

Sistema PECVD RF KINTEK: Deposizione di precisione di film sottili per semiconduttori, ottica e MEMS. Processo automatizzato a bassa temperatura con film di qualità superiore. Sono disponibili soluzioni personalizzate.

Ulteriori informazioni

Forma dell'apparecchiatura

- Tipo a scatola: il coperchio superiore orizzontale apre la porta e la camera di deposizione e la camera di scarico sono saldate integralmente;
- L'intera macchina: il motore principale e il quadro elettrico sono integrati (la camera del vuoto è a sinistra e il quadro elettrico è a destra).

Camera del vuoto

- Dimensioni: $\Phi 420$ mm (diametro) $\times$ 400 mm (altezza); realizzata in acciaio inox SUS304 di alta qualità 0Cr18Ni9, la superficie interna è lucidata, è richiesta una lavorazione accurata senza giunzioni a saldare grossolane; sulla parete della camera sono presenti tubi per l'acqua di raffreddamento;
- Porta di estrazione dell'aria: Rete a doppio strato in acciaio inox 304 con intervalli anteriori e posteriori di 20 mm, deflettore antivegetativo sullo stelo alto della valvola e piastra di equalizzazione dell'aria all'imbocco del tubo di scarico per evitare l'inquinamento;
- Metodo di tenuta e schermatura: la porta della camera superiore e la camera inferiore sono sigillate da un anello di tenuta per sigillare il vuoto, mentre il tubo di rete in acciaio inox viene utilizzato all'esterno per isolare la sorgente di radiofrequenza, schermando i danni causati dai segnali di radiofrequenza alle persone;
- Finestra di osservazione: Due finestre di osservazione da 120 mm sono installate sulla parte anteriore e laterale; il vetro antivegetativo è resistente alle alte temperature e alle radiazioni e consente di osservare comodamente il substrato;
- Modalità di flusso dell'aria: il lato sinistro della camera è pompato dalla pompa molecolare e il lato destro è gonfiato dall'aria per formare una modalità di lavoro convettiva di carica e pompaggio per garantire che il gas fluisca uniformemente verso la superficie del bersaglio ed entri nell'area del plasma per ionizzare completamente e depositare il film di carbonio;
- Materiale della camera: il corpo della camera da vuoto e la porta di scarico sono realizzati in acciaio inossidabile SUS304 di alta qualità 0Cr18Ni9, mentre il coperchio superiore è realizzato in alluminio di elevata purezza per ridurre il peso della parte superiore.

Scheletro ospite

- Realizzato in profilato d'acciaio (materiale: Q235-A), il corpo della camera e il quadro elettrico sono integrati.

Sistema di raffreddamento ad acqua

- Condotte: Le tubazioni principali di ingresso e di uscita dell'acqua sono realizzate con tubi in acciaio inox;
- Valvola a sfera: Tutti i componenti di raffreddamento sono alimentati separatamente con acqua attraverso valvole a sfera 304, e i tubi di ingresso e di uscita dell'acqua hanno distinzioni di colore e segni corrispondenti, e le valvole a sfera 304 per i tubi di uscita dell'acqua possono essere aperte e chiuse separatamente; l'obiettivo, l'alimentazione RF, la parete della camera, ecc. sono dotati di protezione del flusso d'acqua, e c'è un allarme di interruzione dell'acqua per evitare che il tubo dell'acqua sia bloccato. Tutti gli allarmi relativi al flusso d'acqua vengono visualizzati sul computer industriale;
- Visualizzazione del flusso d'acqua: Il target inferiore è dotato di monitoraggio del flusso d'acqua e della temperatura e la temperatura e il flusso d'acqua vengono visualizzati sul computer industriale;
- Temperatura dell'acqua fredda e calda: quando il film viene depositato sulla parete della camera, l'acqua fredda viene fatta passare a 10-25 gradi per raffreddare l'acqua e viene fatta avanzare quando si apre la porta della camera. Passare l'acqua calda a 30-55 gradi per raffreddare l'acqua.

Armadio di controllo	• Struttura: sono stati adottati armadi verticali, l'armadio di installazione degli strumenti è un armadio di controllo standard internazionale da 19 pollici, mentre l'armadio di installazione degli altri componenti elettrici è una struttura a pannelli di grandi dimensioni con una porta posteriore; • Pannello: I principali componenti elettrici dell'armadio di controllo sono tutti selezionati da produttori che hanno superato la certificazione CE o ISO9001. Installare una serie di prese di corrente sul pannello; • Metodo di connessione: l'armadio di controllo e l'host sono in una struttura congiunta, il lato sinistro è il corpo della stanza, il lato destro è l'armadio di controllo, e la parte inferiore è dotata di una fessura dedicata per i fili, ad alta e bassa tensione, e il segnale RF è separato e instradato per ridurre le interferenze; • Impianto elettrico a bassa tensione: Interruttore e contattore francese Schneider per garantire un'alimentazione affidabile delle apparecchiature; • Prese: Prese di ricambio e prese per la strumentazione sono installate nell'armadio di controllo.
Vuoto finale	• Atmosfera a 2×10^{-4} Pa ≤ 24 ore (a temperatura ambiente e con la camera del vuoto pulita).
Ripristino del tempo di vuoto	• Atmosfera a 3×10^{-3} Pa ≤ 15 min (a temperatura ambiente e la camera del vuoto è pulita, con deflettori, portaombrelli e senza substrato).
Velocità di aumento della pressione	• $\leq 1,0 \times 10^{-1}$ Pa/h
Configurazione del sistema del vuoto	• Composizione del set di pompe: pompa di supporto BSV30 (Ningbo Boss) + pompa Roots BSJ70 (Ningbo Boss) + pompa molecolare FF-160 (Pechino); • Metodo di pompaggio: pompaggio con dispositivo di pompaggio morbido (per ridurre l'inquinamento del substrato durante il pompaggio); • Connessione dei tubi: il tubo del sistema di vuoto è realizzato in acciaio inossidabile 304 e la connessione morbida del tubo è realizzata con; • Soffietti metallici; ogni valvola per il vuoto è una valvola pneumatica; • Porta di aspirazione dell'aria: Per evitare che il materiale della membrana inquina la pompa molecolare durante il processo di evaporazione e migliorare l'efficienza di pompaggio, tra la porta di aspirazione dell'aria del corpo della camera e la camera di lavoro viene utilizzata una piastra di isolamento mobile facile da smontare e pulire.
Misurazione del sistema del vuoto	• Display del vuoto: tre bassi e un alto (3 gruppi di regolazione ZJ52 + 1 gruppo di regolazione ZJ27); • Misuratore di vuoto alto: Il misuratore di ionizzazione ZJ27 è installato sulla parte superiore della camera di pompaggio della scatola del vuoto, vicino alla camera di lavoro, e il campo di misurazione va da $1,0 \times 10^{-1}$ Pa a $5,0 \times 10^{-5}$ Pa; • Misuratori di basso vuoto: una serie di misuratori ZJ52 è installata sulla parte superiore della camera di pompaggio della scatola del vuoto, mentre l'altra serie è installata sul tubo di pompaggio grezzo. Il campo di misura va da $1,0 \times 10^{-5}$ Pa a $5,0 \times 10^{-1}$ Pa; • Regolazione di lavoro: Il misuratore capacitivo CDG025D-1 è installato sul corpo della camera e il campo di misura va da $1,33 \times 10^{-1}$ Pa a $1,33 \times 10^{-2}$ Pa, per il rilevamento del vuoto durante la deposizione e il rivestimento, in combinazione con la valvola a farfalla a vuoto costante.
Funzionamento del sistema del vuoto	Esistono due modalità di selezione del vuoto manuale e automatico; • Il PLC giapponese Omron controlla tutte le pompe, l'azione della valvola del vuoto e la relazione di interblocco tra il lavoro della valvola di arresto dell'inflazione per garantire che l'apparecchiatura possa essere protetta automaticamente in caso di funzionamento errato; • Il segnale di posizione della valvola alta, della valvola bassa, della pre-valvola, della valvola alta di bypass viene inviato al segnale di controllo del PLC per garantire una funzione di interblocco più completa; • Il programma PLC può svolgere la funzione di allarme di ogni punto di guasto dell'intera macchina, come la pressione dell'aria, il flusso dell'acqua, il segnale della porta, il segnale di protezione da sovracorrente, ecc. e l'allarme, in modo che il problema possa essere individuato rapidamente e comodamente; • Il touch screen da 15 pollici è il computer superiore e il PLC è il computer inferiore di monitoraggio e controllo della valvola. Il monitoraggio online di ogni componente e i vari segnali vengono inviati al software di configurazione del controllo industriale in tempo utile per l'analisi e il giudizio e vengono registrati; • Quando il vuoto è anormale o l'alimentazione viene interrotta, la pompa molecolare della valvola del vuoto deve tornare allo stato chiuso. La valvola del vuoto è dotata di una funzione di protezione interbloccata e l'ingresso dell'aria di ciascun cilindro è dotato di un dispositivo di regolazione della valvola di intercettazione; è inoltre presente una posizione di impostazione del sensore per visualizzare lo stato di chiusura del cilindro;
Test del vuoto	• Secondo le condizioni tecniche generali della macchina per il rivestimento sottovuoto GB11164.

Forno Tubolare Cvd A Camera Split Con Macchina Cvd A Stazione Sottovuoto

Numero articolo: KT-CTF12



introduzione

Forno tubolare CVD a camera split con stazione del vuoto - Forno da laboratorio ad alta precisione a 1200°C per la ricerca sui materiali avanzati. Sono disponibili soluzioni personalizzabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	KT-CTF12-60
Temperatura massima	1200°C
Temperatura di lavoro costante	1100°C
Materiale del tubo del forno	Quarzo di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Lunghezza della zona di riscaldamento	1x450mm
Materiale della camera	Fibra di allumina giapponese
Elemento di riscaldamento	Bobina di filo Cr2Al2Mo2
Velocità di riscaldamento	0-20°C/min
Coppia termica	Costruire in tipo K
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Distanza di scorrimento	600 mm
Unità di controllo preciso del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controller touch screen
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette

Portata della pompa	4L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10-5Pa
Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate	

No.	Descrizione	Quantità
1	Fornace	1
2	Tubo di quarzo	1
3	Flangia per il vuoto	2
4	Blocco termico del tubo	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Controllo preciso del gas	1
8	Unità per il vuoto	1
9	Manuale operativo	1

Multi Zone Di Riscaldamento Cvd Tubo Forno Macchina Per Attrezzature Di Deposizione Di Vapore Chimico

Numero articolo: KT-CTF14



introduzione

I forni tubolari CVD a più zone di KINTEK offrono un controllo preciso della temperatura per la deposizione avanzata di film sottili. Ideali per la ricerca e la produzione, sono personalizzabili in base alle esigenze del vostro laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello del forno	KT-CTF14-60
Temperatura massima	1400°C
Temperatura di lavoro costante	1300°C
Materiale del tubo del forno	Tubo Al2O3 di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Zona di riscaldamento	2x450mm
Materiale della camera	Fibra policristallina di allumina
Elemento di riscaldamento	Carburo di silicio
Velocità di riscaldamento	0-10°C/min
Coppia termica	Tipo S
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Unità di controllo preciso del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controllore touch screen
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S

Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10-5Pa

Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate

No.	Descrizione	Quantità
1	Fornace	1
2	Tubo di quarzo (o altro materiale secondo l'ordine)	1
3	Set di flange per il vuoto	2
4	Blocco termico per tubi	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Unità di controllo preciso del gas (se ordinata)	1
8	Unità di vuoto (se ordinata)	1
9	Manuale d'uso	1

Macchina Versatile Su Misura Dell'attrezzatura Di Deposizione Di Vapore Chimica Del Forno Della Metropolitana Di Cvd

Numero articolo: KT-CTF16



introduzione

Il forno tubolare CVD di KINTEK offre un controllo preciso della temperatura fino a 1600°C, ideale per la deposizione di film sottili. Personalizzabile per esigenze di ricerca e industriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello del forno	KT-CTF16-60
Temperatura massima	1600°C
Temperatura di lavoro costante	1550°C
Materiale del tubo del forno	Tubo Al ₂ O ₃ di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Zona di riscaldamento	3x300mm
Materiale della camera	Fibra policristallina di allumina
Elemento di riscaldamento	Carburo di silicio
Velocità di riscaldamento	0-10°C/min
Coppia termica	Tipo S
Controllore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Unità di controllo preciso del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali gas	3 canali (personalizzabili)
Portata (esempio)	MFC1: 0-5SCCM O ₂ MFC2: 0-20SCCM CH ₄ MFC3: 0-100SCCM H ₂ MFC4: 0-500 SCCM N ₂ (personalizzabile)
Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controller touch screen
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S

Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10 ⁻⁵ Pa

Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate

No.	Descrizione	Quantità
1	Corpo del forno con controllo della temperatura	1
2	Tubo in allumina di elevata purezza o quarzo (come da ordine)	1
3	Flange di tenuta al vuoto con porte	2 set
4	Blocchi termici/tappi per tubi	2
5	Gancio per blocco termico a tubo	1
6	Guanti resistenti al calore	1 paio
7	Unità di controllo gas di precisione (MFC come da ordine)	1 set
8	Unità per il vuoto (pompa e manometro come da ordine)	1 set
9	Manuale operativo	1

Forno A Tubo Pecvd A Scorrimento Con Gassificatore Liquido Macchina Pecvd

Numero articolo: KT-PE12



introduzione

Forno a tubo PECVD KINTEK Slide: deposizione di precisione di film sottili con plasma RF, cicli termici rapidi e controllo del gas personalizzabile. Ideale per semiconduttori e celle solari.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello del forno	KT-PE12-60
Temperatura massima	1200°C
Temperatura di lavoro costante	1100°C
Materiale del tubo del forno	Quarzo di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Lunghezza della zona di riscaldamento	1x450mm
Materiale della camera	Fibra di allumina giapponese
Elemento di riscaldamento	Bobina di filo Cr2Al2Mo2
Velocità di riscaldamento	0-20°C/min
Coppia termica	Costruire in tipo K
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Distanza di scorrimento	600 mm
Unità al plasma RF	
Potenza di uscita	5 -500W regolabile con una stabilità di ±1%
Frequenza RF	13,56 MHz ±0,005% di stabilità
Potenza di riflessione	350W max.
Corrispondenza	Automatico
Rumore	
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria.
Unità di controllo di precisione del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2

Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controllore touch screen

Unità di vuoto standard (opzionale)

Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa

Unità per alto vuoto (opzionale)

Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10 ⁻⁴ Pa

Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate

No.	Descrizione	Quantità
1	Forno	1
2	Tubo di quarzo	1
3	Flangia per il vuoto	2
4	Blocco termico del tubo	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Sorgente di plasma RF	1
8	Controllo preciso del gas	1
9	Unità per il vuoto	1
10	Manuale operativo	1

Macchina Rotante Inclinata Del Forno A Tubo Pecvd Della Deposizione Chimica Potenziata Dal Plasma

Numero articolo: KT-PE16



introduzione

Forno a tubo PECVD avanzato per la deposizione precisa di film sottili. Riscaldamento uniforme, sorgente di plasma RF, controllo del gas personalizzabile. Ideale per la ricerca sui semiconduttori.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	PE-1600-60
Temperatura massima	1600°C
Temperatura di lavoro costante	1550°C
Materiale del tubo del forno	Tubo Al2O3 di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Lunghezza della zona di riscaldamento	2x300mm
Materiale della camera	Fibra di allumina del Giappone
Elemento di riscaldamento	Disiliciuro di molibdeno
Velocità di riscaldamento	0-10°C/min
Coppia termica	Tipo B
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Unità al plasma RF	
Potenza di uscita	5 -500W regolabile con una stabilità di ±1%
Frequenza RF	13,56 MHz ±0,005% di stabilità
Potenza di riflessione	350W max.
Corrispondenza	Automatico
Rumore	<50 dB
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria.
Unità di controllo precisa del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali del gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM H4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
Linearità	±0,5% F.S.

Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controllore touch screen
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10-5Pa
Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate	

No.	Descrizione	Quantità
1	Fornace	1
2	Tubo di quarzo	1
3	Flangia per il vuoto	2
4	Blocco termico del tubo	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Sorgente di plasma RF	1
8	Controllo preciso del gas	1
9	Unità per il vuoto	1
10	Manuale operativo	1

Macchina Rotante Inclinata Del Forno A Tubo Pecvd Della Deposizione Chimica Potenziata Dal Plasma

Numero articolo: KT-PED



introduzione

La macchina di rivestimento PECVD di KINTEK produce film sottili di precisione a basse temperature per LED, celle solari e MEMS. Soluzioni personalizzabili e ad alte prestazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Portacampioni	Dimensioni	1-6 pollici
	Velocità di rotazione	0-20 giri/minuto regolabile
	Temperatura di riscaldamento	$\leq 800^{\circ}\text{C}$
	Precisione di controllo	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Regolatore PID SHIMADEN
Spurgo del gas	Misuratore di flusso	CONTROLLORE DEL FLUSSIMETRO DI MASSA (MFC)
	Canali	4 canali
	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua circolante
Camera a vuoto	Dimensione della camera	$\Phi 500\text{mm} \times 550\text{mm}$
	Porta di osservazione	Porta di osservazione completa con deflettore
	Materiale della camera	Acciaio inox 316
	Tipo di porta	Porta ad apertura frontale
	Materiale del tappo	Acciaio inox 304
	Attacco pompa del vuoto	Flangia CF200
	Porta di ingresso del gas	Connettore $\Phi 6$ VCR
Potenza del plasma	Alimentazione della sorgente	Alimentazione CC o RF
	Modalità di accoppiamento	Accoppiamento induttivo o capacitivo a piastra
	Potenza di uscita	500W-1000W
	Potenza di polarizzazione	500v
Pompa a vuoto	Pre-pompa	15L/S Pompa per vuoto a palette
	Porta della pompa turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Porta di scarico	KF25
	Velocità della pompa	Pompa a palette: 15L/s □ Pompa turbo: 1200L/s □ 1600L/s
	Grado di vuoto	$\leq 5 \times 10^{-5}\text{Pa}$
	Sensore di vuoto	Vuoto a ionizzazione/resistenza/manometro a film
Sistema	Alimentazione elettrica	AC 220V /380 50Hz

Potenza nominale	5kW
Dimensioni	900 mm X 820 mm X870 mm
Peso	200 kg



Kintek Furnace

Sede centrale: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, Cina

WhatsApp Image not found or type unknown